



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 19/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. August 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 015 641.2

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie des Richters Dipl.-Ing. Veit, der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 G vom 25. Februar 2011 wird aufgehoben und die Sache wird zur erneuten Entscheidung in der Sache zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 015 641.2 wurde am 31. März 2006 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung" beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 11. Oktober 2007.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften genannt:

- D1 WO 2005/101 924 A1**
- D2 DE 10 2004 005 241 B4**

In der Beschreibungseinleitung ist weiter die Druckschrift

WO 2005/025280 A2

erwähnt.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 05 G hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. Februar 2011 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihr Patentbegehren auf Grundlage der in der mündlichen Verhandlung von 14. August 2014 überreichten Patentansprüche weiterverfolgt.

Die Anmelderin beantragt auf der Grundlage folgender Unterlagen das Patent zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 15, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2014,
sowie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der geltende **Patentanspruch 1** lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M1** Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung, enthaltend
 - M2** eine Entladungskammer,
 - M2.1** die einen Entladungsbereich für eine Gasentladung zur Ausbildung eines die Strahlung abgebenden Plasmas aufweist,
 - M3** eine erste und eine zweite scheibenförmige Elektrode,
 - M3.1** wobei mindestens eine der Elektroden drehbar gelagert ist und
 - M3.2** einen mit einer metallischen Schmelze zu bedeckenden Randbereich aufweist,
 - M4** eine Energiestrah Quelle zur Bereitstellung eines Vorionisationsstrahls und
 - M5** einen mit den Elektroden verbundenen Entladungsschaltkreis zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen,
- wobei
- M6** der zu bedeckende Randbereich mindestens einen entlang des Elektrodenrandes auf der Elektrodenoberfläche geschlossen umlaufenden und für die metallische Schmelze benetzend ausgebildeten Aufnahmebereich (3) aufweist,

- M7** auf den eine Fluidabgabedüse (4, 11, 20) zum regenerativen Auftragen der metallischen Schmelze in Form eines Fluidstrahls (5) gerichtet ist,
- M8** die Elektroden (1, 9) als Kreisscheiben ausgebildet, mit gegenseitigem Abstand starr miteinander verbunden und um eine gemeinsame, mit deren mittleren Symmetrieachsen zusammenfallende Rotationsachse (R-R) drehbar gelagert sind,
- M9** wobei jede der Elektroden (1, 9) auf einander zugewandten Elektrodenoberflächen den mindestens einen für die metallische Schmelze benetzend ausgebildeten Aufnahmebereich (3) enthält, auf den eine Fluidabgabedüse (4, 11) gerichtet ist
- M10** in dem für die Aufbringung der metallischen Schmelze vorgesehenen Elektrodenbereich ein scheibenförmiger Isolationskörper (13) vorgesehen ist, der in den Zwischenraum zwischen den beiden Elektroden (1, 9) eintaucht, und
- M11** die auf die Elektrodenoberflächen der beiden Elektroden (1, 9) gerichteten Fluidabgabedüsen (4, 11) von entgegengesetzten Seiten durch den Isolationskörper (13) hindurchgeführt sind.

Der geltende, nebengeordnete **Patentanspruch 5** lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M1** Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung, enthaltend
- M2** eine Entladungskammer,
- M2.1** die einen Entladungsbereich für eine Gasentladung zur Ausbildung eines die Strahlung abgebenden Plasmas aufweist,
- M3** eine erste und eine zweite scheibenförmige Elektrode,
- M3.1** wobei mindestens eine der Elektroden drehbar gelagert ist und
- M3.2** einen mit einer metallischen Schmelze zu bedeckenden Randbereich aufweist,
- M4** eine Energiestrahlsquelle zur Bereitstellung eines Vorionisationsstrahls und

- M5** einen mit den Elektroden verbundenen Entladungsschaltkreis zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen,
- wobei
- M6** der zu bedeckende Randbereich mindestens einen entlang des Elektrodenrandes auf der Elektrodenoberfläche geschlossen umlaufenden und für die metallische Schmelze benetzend ausgebildeten Aufnahmebereich (3) aufweist,
- M7** auf den eine Fluidabgabedüse (4, 11, 20) zum regenerativen Auftragen der metallischen Schmelze in Form eines Fluidstrahls gerichtet ist, und
- N8** die erste Elektrode (14) um eine mit ihrer mittleren Symmetrieachse zusammenfallenden Rotationsachse (R'-R') drehbar gelagert und die zweite Elektrode (15) feststehend ausgebildet ist,
- N9** und die drehbar gelagerte erste Elektrode (14) einen kleineren Durchmesser als die feststehende zweite Elektrode (15) aufweist sowie
- N10** außeraxial in eine Aussparung (16) der zweiten Elektrode (15) eingelassen ist,
- N11** wobei die Fluidabgabedüse (20) durch eine Öffnung (19) in der Aussparung auf den mindestens einen, für das Emittermaterial benetzend ausgebildeten Aufnahmebereich (3) auf der Elektrodenoberfläche der ersten Elektrode (14) gerichtet ist.

Wegen der Unteransprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur weiteren Prüfung auf Basis der in der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2014 eingereichten Patentan-

sprüche an das Deutsche Patent- und Markenamt führt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Patentansprüche 1 bis 15 sind zulässig, da ihre Merkmale in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen jeweils als zur Erfindung gehörend offenbart sind.

Der Patentanspruch 1 stützt sich auf den ursprünglichen Patentanspruch 1, der mittels der Beschreibung S.7 zweiter Absatz hinsichtlich des Fluidstrahls präzisiert wurde, und die ursprünglichen Patentansprüche 3 bis 5.

Die Patentansprüche 2 bis 15 entsprechen den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 6, 7, 8 bis 18, wobei im neuen Anspruch 8 der Rückbezug verallgemeinert wurde. Dies ist ebenfalls der ursprünglichen Beschreibung eindeutig und unmittelbar als zur Erfindung gehörig zu entnehmen und daher nicht zu beanstanden.

2. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung mit einer Entladungskammer, die einen Entladungsbereich für eine Gasentladung zur Ausbildung eines die Strahlung abgebenden Plasmas aufweist, einer ersten und einer zweiten scheibenförmigen Elektrode, wobei mindestens eine der Elektroden drehbar gelagert ist und einen mit einer metallischen Schmelze zu bedeckenden Randbereich aufweist, einer Energiestrahlnquelle zur Bereitstellung eines Vorionisationsstrahls und mit einem, mit den Elektroden verbundenen Entladungsschaltkreis zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]).

Bei der EUV-Projektionslithographie haben sich nach der Beschreibungseinleitung Drehelektroden als viel versprechende Lösung zur deutlichen Steigerung der Lebensdauer von Gasentladungsquellen herausgestellt. Vorteile bestünden darin, dass diese insbesondere scheibenförmig ausgebildeten Elektroden zum einen besser gekühlt werden können. Zum anderen könne die Limitation der Lebensdauer aufgrund der unvermeidbaren Elektrodenerosion mittels einer ständig er-

neuerten Elektrodenoberfläche aufgehoben werden (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]).

Eine vorbekannte Vorrichtung gemäß der WO 2005/025280 A2 nutze rotierende Elektroden, die in einen Behälter mit einer Metallschmelze eintauchen. Das auf die Elektrodenoberfläche aufgetragene Metall wird mittels Laserstrahlung verdampft, wonach der Dampf durch eine Gasentladung zu einem Plasma gezündet wird (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]).

Von **Nachteil** an dieser technischen Lösung sei vor allem, dass sich eine gewünschte Schichtdicke des aufgetragenen Materials nur schwer einstellen lässt und dass einerseits ab gewissen Drehzahlen beim teilweisen Eintauchen der scheibenförmig ausgebildeten Elektroden in die Metallschmelze Spritzer und Materialtransport aus dem Bad auftreten (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0005]). Andererseits führe eine zu geringe Rotationsgeschwindigkeit zu einer zu langsamen Nachführung eines unverbrauchten Elektrodenabschnittes in den Entladungsbereich und damit zu Instabilitäten der Plasmaerzeugung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0006]).

Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die in der Patentanmeldung angegebene **Aufgabe** zugrunde, eine Verbesserung der Schichtdickeneinstellung beim Aufbringen einer metallischen Schmelze auf die Elektrodenoberflächen zu erreichen und die mit einer Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit der Elektroden verbundene unkontrollierte Ausbreitung der metallischen Schmelze in der Umgebung besser zu verhindern. Die Rotationsgeschwindigkeit soll insbesondere soweit erhöht werden können, dass bei Repetitionsfrequenzen von mehreren Kilohertz stets unverbrauchte Entladungsgebiete der Elektroden sich im Entladungsbereich befinden (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0008]).

3. Die Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß u. a. dadurch erreicht, dass der zu bedeckende Randbereich mindestens einen entlang des Elektrodenrandes auf

der Elektrodenoberfläche geschlossen umlaufenden und für die metallische Schmelze benetzend ausgebildeten Aufnahmebereich aufweist, auf den eine Fluidabgabedüse zum regenerativen Auftragen der metallischen Schmelze gerichtet ist.

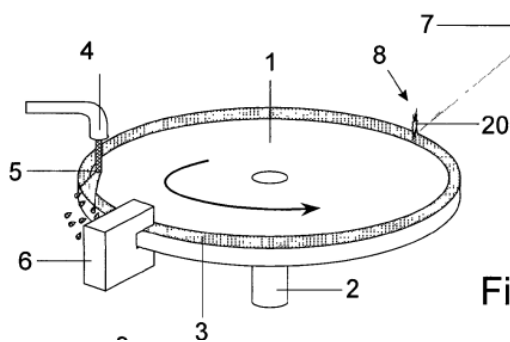


Fig. 1

Die nebenstehende Figur 1 aus der Patentanmeldung zeigt das erfindungsgemäße Prinzip des Aufbringens einer definierten dünnen Schicht einer metallischen Schmelze entlang einer Spur (Aufnahmebereich 3) auf einer rotierenden Elektro-

denoberfläche (Elektrode 1) mittels Fluidabgabedüse (4).

4. Die Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung nach Patentanspruch 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, eines Diplom-Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von EUV-Vorrichtungen.

Die Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1 ist gegeben, da keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften alle Merkmale der Vorrichtung nach Anspruch 1 zeigt, wie die nachfolgenden Ausführungen belegen.

Die nächstliegende Druckschrift **D1** offenbart eine Vorrichtung zur Erzeugung von extrem ultravioletter Strahlung (EUV) mittels einer elektrisch betriebenen Gasentladung (vgl. D1 S.1 Z.13-15: „The invention relates to a device and a method for obtaining primarily extreme ultraviolet (EUV) radiation from a dense, hot plasma of pinch-type discharges“) [= Merkmal **M1**].

Diese enthält eine Entladungskammer (discharge chamber 9), die einen Entladungsbereich (discharge zone) für eine Gasentladung zur Ausbildung eines die

Strahlung abgebenden Plasmas aufweist (vgl. D1 S.7 Z.23-29: „Electrodes 1, 2 are accommodated in the discharge chamber 9. In proximity to the discharge zone, whose location is determined by the focus of the beam from the vapor channel formation device 5, a blade 10 is mounted, which prevents working substance vapors and discharge plasma ions from spreading into the EUV radiation discharge area.“, Fig. 1) [= Merkmale **M2** und **M2.1**].

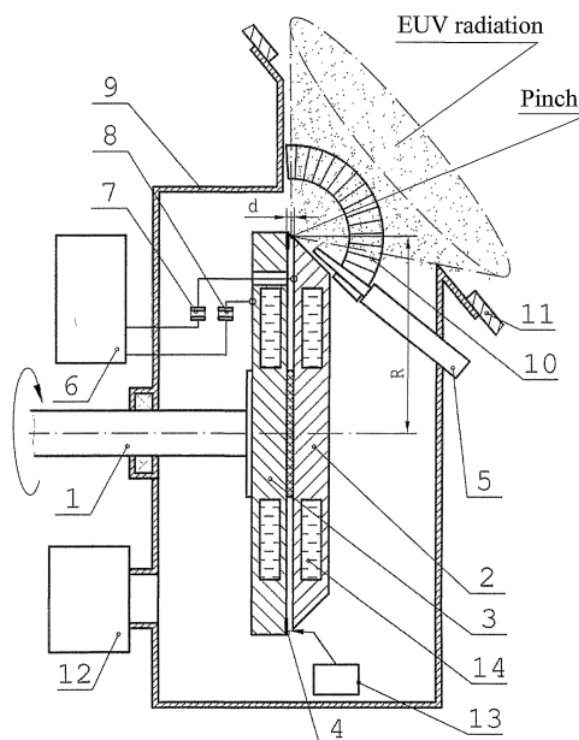


Fig. 1

Weiter ist eine erste und eine zweite scheibenförmige Elektrode (electrodes 2, 3) vorhanden (vgl. D1 S. 7 Z. 2-4: „The EUV source contains electrodes 2, 3 ... designed as disk-shaped elements whose central axes of symmetry overlap the shaft axis“, Fig. 1) [= Merkmal **M3**], wobei zumindest eine Elektrode drehbar gelagert ist (vgl. D1 S. 7 Z. 2-3, Z.23-23: „rotating electrodes“) [= Merkmal **M3.1**] und einen mit einer metallischen Schmelze zu bedeckenden Randbereich aufweist (vgl. D1 S. 7 Z. 10-11: „the layer 4 of low-melting metal covering the peripheral part of the surface of the electrode 3“, Fig. 1) [= Merkmal **M3.2**]. Dabei sind die

Elektroden (2, 3) als Kreisscheiben ausgebildet, mit gegenseitigem Abstand starr miteinander verbunden und um eine gemeinsame, mit deren mittleren Symmetrieachsen zusammenfallende Rotationsachse (R-R) drehbar gelagert (vgl. D1 S. 3 Z. 25: „with rotating electrodes rigidly secured to the shaft“, Fig. 1) [= Merkmal **M8**].

Weiter wird zur Bereitstellung eines Vorionisationsstrahls eine Energiestrahlsquelle (device 5 for forming a vapor channel) und zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen ein mit den Elektroden verbundener Entladungsschaltkreis verwendet (vgl. D1 S. 7 Z. 14-15: „The pulse supply source 6 is connected to the electrodes 2, 3“, Fig. 1) [= Merkmale **M4** und **M5**].

Der Fachmann liest aufgrund der Rotation und der kontinuierlichen Benetzung mit, dass der mit einer metallischen Schmelze zu bedeckende Randbereich nach Merkmal **M3.2** geschlossen umlaufend ist. Dieser Randbereich stellt auch den Aufnahmebereich gemäß Merkmal **M6** dar, der durch den Anspruch 1 nicht näher definiert ist. Dieser Aufnahmebereich ist auch nicht auf die in der Patentanmeldung genannten Materialien (S. 6 erster Absatz: „beispielsweise aus Kupfer, Chrom, Nickel, oder Gold“) eingeschränkt. Entgegen der Ausführungen der Patentanmelderin ergibt sich damit das Merkmal **M6**, da das aufgetragene Metall bei der bekannten Vorrichtung auch auf dem Aufnahmebereich anhaften und eine Schicht (layer) bilden soll.

Auf diesen Aufnahmebereich ist die Vorrichtung (system 13 for supplying low-melting metal) zum regenerativen Auftragen der metallischen Schmelze gerichtet (vgl. D1 Fig. 1).

Für das in Figur 1 offenbarte Ausführungsbeispiel ist diese Vorrichtung (13) nicht näher definiert. Im in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel werden als Beispiele eine Zinnbeschichtung durch Eintauchen in ein Bad („tinning“), Metallisierung („metallizing“) oder Aufbringen mittels hydraulischen Befüllen („hydraulic filling of porous structures“) genannt (vgl. D1 S. 8 Z. 10-14: „The system 13 is

used for supplying low-melting metal on the surface of electrodes 2, 3 based on one of following methods: tinning (wetting), metallizing, hydraulic filling of porous structures incorporated in the electrode material.“).

Der Fachmann könnte diese Verfahren auch für die Vorrichtung nach Figur 1 verwenden, er ist darauf jedoch nicht eingeschränkt. Bei der Realisierung der Vorrichtung zum Auftragen der metallischen Schmelze wird er auch Methoden in Betracht ziehen, die ihm aus seinem Fachwissen und dem Fachgebiet bekannt sind.

Gehört eine technische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann eine Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH-Farbversorgungssystem, Urteil vom 11. März 2014, X ZR 139/10).

Dies ist vorliegend der Fall, da die Verwendung einer Fluidabgabedüse zum Zuführen eines flüssigen Metalls zum allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns im Sinne eines "Standardrepertoires" zählt.

Es erscheint auch nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, eine Düse zum Einbringen von Metall in einer EUV-Vorrichtung zu verwenden, da dies aus der Druckschrift D2 bekannt ist. Unbestritten ist aus der Druckschrift D2 bekannt, einen Targetstrom mittels einer Injektionsdüse zu einem Reaktionsort zu liefern. Auch diese Vorrichtung wird der Fachmann in Betracht ziehen, da er - obwohl keine rotierenden Elektroden vorhanden sind und damit das Zuführen nicht zur Beschichtung sondern als Targetstrom verwendet wird – ebenfalls Lösungen bei der Realisierung des Zuführens einer Metallschmelze zu erwarten sind.

Bei der Übertragung dieser Standardlösung des Auftragens mittels Düse auf die Vorrichtung nach der Druckschrift D1 wird der Fachmann daher im Rahmen

fachmännischen Handelns die Vorrichtung (13) in der Druckschrift D1 als Fluidabgabedüse ausbilden [= Merkmal **M7**].

Die Fluidabgabe-Vorrichtung (13) nach der Druckschrift D1 ist nach Fig. 1 nur auf eine Elektrode gerichtet. Es liegt jedoch im fachmännischen Handeln, ebenfalls – analog zum Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 beide Elektroden mit der metallischen Schmelze zu benetzen und Fluidabgabedüsen hierauf zu richten [= Merkmal **M9**].

Dabei ist es noch dem fachmännischen Handeln zuzuordnen, einen scheibenförmigen Isolationskörper vorzusehen, der in den Zwischenraum zwischen den beiden Elektroden eintaucht, um Kurzschluss zu vermeiden [Merkmal **M10**] – auch in der Vorrichtung nach der Druckschrift D1 sind die Elektroden mittels einem Bauteil (vgl. Fig. 1) getrennt. Jedoch ergibt sich aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik keine Veranlassung Fluiddüsen vorzusehen, die auf die Elektrodenoberflächen der beiden Elektroden (2, 3) von entgegengesetzten Seiten gerichtet sind und die von entgegengesetzten Seiten durch den scheibenförmigen Isolationskörper (13) hindurchgeführt werden [Merkmal **M11**].

Der Fachmann hatte auch aufgrund seines Fachkönnens und Fachwissens oder aus der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschrift D2 keine Anregung zur Ausbildung der Vorrichtung nach Merkmal M11.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist somit gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik patentfähig.

5. Das Verfahren ist noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen.

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das

Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Diese Voraussetzungen liegen vor, wenn die Mängel, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt wurden, danach aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Die Anmeldung kann an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit des nunmehr Beanspruchten noch nicht Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Aufl. § 79 Rdn. 25 bis 27 – jeweils mit weiteren Hinweisen).

Dies ist vorliegend der Fall. Die Merkmale des geltenden, nebengeordneten Anspruchs 5 haben ersichtlich im bisherigen Prüfungsverfahren noch keine Rolle gespielt. Die Prüfungsstelle hat im bisherigen Prüfungsverfahren noch keinen Stand der Technik ermittelt, auf dessen Grundlage eine merkmalsbezogene Sachprüfung des Gegenstandes nach Anspruch 5 erfolgen könnte.

Da die Recherche insoweit lediglich als vorläufig anzusehen ist, ist nicht auszuschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich der Merkmale im nebengeordneten Anspruch 5 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird.

6. Die von der Anmelderin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen. Auch die Ablehnung einer von einem Anmelder beantragten Anhörung kann einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß darstellen. Dabei rechtfertigt nicht jeder Verfahrensfehler die Rückzahlung. Diese ist vielmehr nur dann billig, wenn ein schwerwiegender Verstoß vorliegt oder wenn der Verfahrensfehler für die Erhe-

bung der Beschwerde ursächlich war (BPatG München, Beschluss vom 22. März 2012 – 8 W (pat) 4/11).

Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsstelle im Bescheid vom 12. Dezember 2006 der Patentanmelderin die negative Beurteilung zur erfinderischen Tätigkeit umfassend begründet und mitgeteilt, dass bei dieser Sachlage eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Im Schriftsatz vom 16. Mai 2007 legte die Patentanmelderin Ihre Gegenauffassung zu den Argumenten der Prüfungsstelle substantiiert dar. Diese führte nicht zur Änderung der Auffassung der Prüfungsstelle, lediglich bezüglich des Merkmals **M6** erfolgt eine Änderung hinsichtlich der expliziten Offenbarung (im Zurückweisungsbeschluss nunmehr eine implizite Offenbarung). Dies ist jedoch nicht als entscheidungserheblicher Grund zu sehen, zu dem sich die Anmelderin nicht äußern konnte. Die Prüfungsstelle setzte sich auch ersichtlich mit der Argumentation der Patentanmelderin auseinander (siehe Zurückweisungsbeschluss S. 3 Abs. 2: Ausführungen zur Argumentation der Patentanmelderin bezüglich des „Aufnahmebereichs“, S. 3 Abs. 3: Ausführungen zur Argumentation der Patentanmelderin bezüglich des „Schmelzbads“, S. 4 Abs. 2: Ausführungen zur Argumentation der Patentanmelderin bezüglich des „Heranziehen der Druckschrift D2“).

Zwar hätte die Prüfungsstelle Ihre unveränderte Auffassung auch in einem weiteren Prüfbescheid oder einer Anhörung darlegen können. Jedoch konnte die Prüfungsstelle nicht annehmen, dass die Anmelderin in einer mündlichen Anhörung ihr Patentbegehren gegenüber dem offenkundig patenthindernden Stand der Technik einschränken würde oder weitere Argumente vorbringen würde. Einen Antrag auf Anhörung wurde von der Anmelderin, auch hilfsweise, nicht gestellt.

Damit ist kein schwerwiegender Verfahrensfehler ersichtlich, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als billig erscheinen lässt.

Da der Senat auch sonst kein rechtsfehlerhaftes Vorgehen der Prüfungsstelle erkennen kann, gibt es keinen Grund, der eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde.

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist für jede am Beschwerdeverfahren beteiligte Person das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe ein-

gereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Veit

Zimmerer

Heimen

Ko